

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges

Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum

30. Oktober 2014 (30.10.2014)



WIPO | PCT



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 2014/173707 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C08G 77/14 (2006.01) C08F 36/04 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01) C08C 19/25 (2006.01)
C08C 19/44 (2006.01) C08K 3/00 (2006.01)
C08F 2/38 (2006.01) C08C 19/30 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01) C08C 19/36 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01) C08F 236/06 (2006.01)
C08L 13/00 (2006.01) C08F 236/10 (2006.01)
B60C 1/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2014/057426

(22) Internationales Anmeldedatum:
11. April 2014 (11.04.2014)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
13165215.8 24. April 2013 (24.04.2013) EP

(71) Anmelder: LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
[DE/DE]; Kennedyplatz 1, 50569 Köln (DE).

(72) Erfinder: STEINHAUSER, Norbert; Lavendelweg 1,
41539 Dormagen (DE). GROß, Thomas; Holunderweg
12, 42489 Wülfrath (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

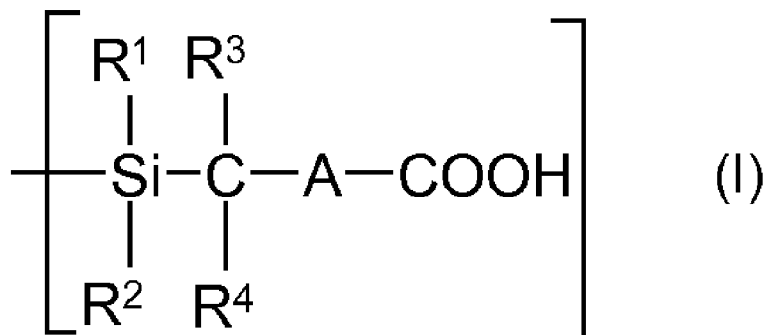
— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu
beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: COLD FLOW REDUCED POLYMERS WITH GOOD PROCESSING BEHAVIOUR

(54) Bezeichnung : COLD FLOW REDUZIERTE POLYMERE MIT GUTEM VERARBEITUNGSVERHALTEN



(57) Abstract: The present invention relates to cold flow reduced polymers with good processing behaviour, these having on the polymer chain end a silane-containing carboxy group of the formula (I), where R¹, R² are identical or different and are an H, alkyl, alkoxy, cycloalkyl, cycloalkoxy, aryl, aryloxy, alkaryl, alkaryloxy, aralkyl or aralkoxy radicals which can contain one or more heteroatoms, preferably O, N, S or Si, R³, R⁴ are identical or different and are an H, alkyl, cycloalkyl, aryl, alkaryl or aralkyl radicals which can contain one or more heteroatoms, preferably O, N, S or Si, A is a divalent organic radical which, besides C and H, can contain one or more heteroatoms, preferably O, N, S or Si.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft Cold Flow reduzierte Polymere mit gutem Verarbeitungsverhalten, wobei diese am Polymerkettenende eine silanhaltige Carboxygruppe der Formel (I) aufweisen, wobei R¹, R² gleich oder verschieden sind und ein H, Alkyl-, Alkoxy-, Cycloalkyl-, Cycloalkoxy-, Aryl-, Aryloxy-, Alkaryl-, Alkaryloxy-, Aralkyl- oder Aralkoxyreste darstellen, die ein oder mehrere Heteroatome, bevorzugt O, N, S oder Si enthalten können, R

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2014/173707 A1



³, R⁴ gleich oder verschieden sind und ein H, Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Alkaryl- oder Aralkylreste darstellen, die ein oder mehrere Heteroatome, bevorzugt O, N, S oder Si enthalten können, A für einen divalenten organischen Rest steht, der neben C und H ein oder mehrere Heteroatome, bevorzugt O, N, S oder Si enthalten kann.